

日本国経済産業省特許庁とインド共和国商工省産業政策振興局との間の産業財産に関する協力覚書(MoC)に対する、第2回日印知的財産評価会合での共同声明

1. 日本国経済産業省特許庁（JPO）とインド商工省産業政策・振興局（DIPP）（以下、「両省」）は、第2回日印知的財産評価会合を2018年8月22日に東京、日本で開催した。
2. 両省は、同会合において、日印の産業財産に関する協力覚書(MoC)及びMoCに基づくJPOとインド特許意匠商標総局（CGPDTM）（以下、「両庁」）のアクションプランの進捗をレビューするとともに、両庁の関心事項についての意見交換を行った。
3. 両省は、社会経済的発展の目標を達成し、イノベーションを促進し、創造性を促進する上で、知的財産の貢献が重要であることを再認識した。
4. 両省は、アクションプランによる様々な協力事項を通じて、日印の知的財産分野における協力が強化されてきたことを認識し、今後も日印の協力関係を継続及び強化することへのコミットメントを確認した。
5. 両省は、目標に向け、知財システムの透明性、予見性、迅速性、明確性及び手続簡素化、知財エンフォースメントの強化、能力構築の強化、知財啓発・イノベーション促進の重要性を認識した。
6. JPOは、インド知財庁による特許及び商標分野の審査待ち期間の短縮に向けた努力を歓迎した。
7. DIPPは、2017年度に行われた招へい研修に加え、新規採用した特許審査官300名以上に対するフォローアップ研修の実施へのJPOの協力を感謝した。また、DIPPは、2019年に採用予定である新人特許審査官を養成することへのJPOの協力を歓迎した。
8. 両省は、前回会合での合意に基づく両庁の専門家からなるPPHワーキング・グループでまとめられ、PPHの詳細な分析を示した共同報告書について議論した。熟慮の後、両省は、必要な手続の完了を条件として、2019年度第1四半期に特定の規定された発明分野における二国間のPPHを試行として開始することに大筋合意した。
9. DIPPはJPOに対し、インド国内に外部事務局を開設する提案が国としてWIPO内で行われたことを情報共有した。
10. 両省は、TKDLをPCT最小限資料とすることを議論することに合意した。

11. 両省は、両庁が各自の出願人に対する ISA/IPEA として機能していることに言及した。
12. 日本産業界は、インド特許商標庁における審査待ち期間を短縮する努力を評価し、これが継続することを希望した。また、日本産業界は、早期審査の要件拡充について提案を行い、DIPP はこれを検討することに合意した。
13. 両省は、各知財庁における IT インフラに関する情報交換を継続することに合意した。
14. 両省は、両庁が 2018 年内に、それらの公式な知財公報の交換を開始することに合意した。
15. 両省は、知財啓発分野での協力としての、前回会合以来行われた招へい研修等を通じたベストプラクティスや活動の共有を歓迎した。さらに両省は、2019 年に日印の小中学生を対象とした知財啓発ワークショップを、デリーにおいて共同で開催することに合意した。
16. 知的財産としての工業意匠の重要性を認識して、両省は、意匠教育に関する協力について議論することに合意した。
17. 知財の商業化の重要性を認識して、両省は、これに関する協力について議論することに合意した。
18. 両省は、次回の日印知的財産評価会合を、相互に決定した日時にデリーで開催することに合意した。
